PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-241474

(43) Date of publication of application: 28.08.2002

(51)Int.CI.

C08G 59/68 C07C381/12 C08F 2/50 C08G 65/18

(21)Application number: 2001-318270

(71)Applicant: NIPPON KAYAKU CO LTD

(22)Date of filing:

16.10.2001

(72)Inventor: TANIGUCHI NOBUO

(30)Priority

Priority number : 2000377849

Priority date: 12.12.2000

Priority country: JP

(54) PHOTOCURABLE RESIN COMPOSITION CONTAINING AROMATIC SULFONIUM COMPOUND

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photo-cation-curable resin composition excellent in transparency and storage stability, and generating no benzene from a photo-cationicpolymerization initiator component, even when the cured film obtained by photo- irradiation is heat treated further.

SOLUTION: This photo-cation-curable resin composition is obtained by compounding a cationically polymerizable compound with a photo-cationic-polymerization initiator which is a synthesized triallyl sulfonium salt having a specific structure wherein all the benzene rings in the structure are directly bonded to carbon atoms as substituents.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-241474 (P2002-241474A)

(43)公開日 平成14年8月28日(2002.8.28)

(51) Int.Cl.7	酸別記号	F I	テーマコード(参考)
C 0 8 G 59/68		C 0 8 G 59/68	4H006
C 0 7 C 381/12		C 0 7 C 381/12	4 J 0 0 ii
C08F 2/50		C08F 2/50	4 J 0 1 1
C 0 8 G 65/18		C 0 8 G 65/18	4 J 0 3 6

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 11 頁)

(21)出願番号	特願2001-318270(P2001-318270)	(71)出顧人	000004086
(22) 川顧日	平成13年10月16日(2001.10.16)	(72)発明者	日本化薬株式会社 東京都千代田区富士見1 「目11番2号 谷口 信雄
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願2000-377849 (P2000-377849) 平成12年12月12日 (2000. 12.12)		東京都北区志茂3-17-2-402

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 芳香族スルホニウム化合物を含有する光硬化性樹脂組成物

(57)【要約】

(33)優先権主張国

【課題】 透明性および保存安定性に優れ、光照射して 得られた硬化膜をさらに加熱処理しても、硬化物の光カ チオン重合開始剤成分からベンゼンを発生することのな い光カチオン硬化性樹脂組成物を提供すること。

日本 (JP)

【解決手段】 構造中のすべてのベンゼン環が置換基として炭素原子と直接結合していることを特徴とした特定の構造を有するトリアリルスルホニウム塩を合成し、これを光カチオン重合開始剤としてカチオン重合性化合物に配合し、光カチオン硬化性樹脂組成物とする。

【特許請求の範囲】 【請求項1】下記式(1) 【化1】

(式中、 $R_1 \sim R_5$ はそれぞれ水素原子、 $C_2 \sim C_{18}$ の直鎖または分岐状のアルキル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、シクロへキシル基、シクロへキシルメチル基、ベンジル基、2-ヒドロキシエチル基、2-エトキシエチル基またはシアノ基からなる群から選ばれるいずれかの置換基を表し、Xは $C_1 \sim C_{18}$ の直鎖または分岐状のアルキル基、トリフルオロメチル基またはペンタフルオロエチル基からなる群から選ばれるいずれかの置換基を表し、Yは1価のアニオンになりうる原子団を表す。ただし、 $R_1 \sim R_5$ のすべてが同時に水素原子を表すことはない。)で表されるトリアリルスルホニウム化合物であることを特徴とする光カチオン重合開始剤(A)と、1種または2種以上のカチオン重合性化合物(B)を含有することを特徴とする光硬化性樹脂組成物。

【請求項2】式(1)において、 $R_1 \sim R_5$ のいずれか1 つがトリフルオロメチル基であり、 $XがC_1 \sim C_4$ の直鎖 または分岐状のアルキル基、トリフルオロメチル基また はペンタフルオロエチル基からなる群から選ばれるいず れかの置換基である光カチオン重合開始剤(A)を含有 することを特徴とする請求項1に記載の光硬化性樹脂組 成物

【請求項3】式(1)において、Y-で表されるアニオン部が SbF_6 -または PF_6 -である光カチオン重合開始剤(A)を含有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項4】前記1種または2種以上のカチオン重合性化合物(B)のうち、少なくとも1種が1分子中に1個以上のエポキシ基を有する化合物であることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか一項に記載の光硬化性樹脂組成物。

【請求項5】光カチオン重合開始剤(A)の添加量が、 前記1種または2種以上のカチオン重合性化合物(B) に対して0.1~10重量%であることを特徴とする請 求項1ないし4のいずれか一項に記載の光硬化性樹脂組 成物。

【請求項6】請求項1ないし5のいずれか一項に記載の 光硬化性樹脂組成物を硬化して得られる硬化物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、トリアリルスルホニウム化合物である光カチオン重合開始剤(A)、およびこれと1種または2種以上のカチオン重合性化合物(B)を含有する光硬化性樹脂組成物、さらにはこの光硬化性樹脂組成物に活性エネルギー線を照射することによって得られる硬化物に関する。

[0002]

【従来の技術】光硬化性樹脂組成物は、印刷インキ、塗 料、コーティング、液状レジストインキ等の分野におい て、省エネルギー、省スペース、無公害性等の要請から 盛んに研究され、工業的に使用されており、これらのう ちの大部分が不飽和二重結合の光ラジカル重合反応を利 用したものである。また最近、エポキシ樹脂に光カチオ ン重合開始剤を含有させて、光カチオン重合させる方法 の工業的な応用が検討されてきている。エポキシ樹脂等 のカチオン重合性物質を紫外線や電子線等の活性エネル ギー線を照射することにより光カチオン重合する方法 は、アクリル酸エステル化合物等を活性エネルギー線の 照射により光ラジカル重合する方法に比べ、硬化収縮が 小さいことや硬化の際に酸素の影響を受けないこと等、 光ラジカル重合で硬化する方法と比較した場合に有利で ある種々の特徴を有している。カチオン重合性物質を紫 外線や電子線等の活性エネルギー線を照射することによ り光カチオン重合させる場合、活性エネルギー線の照射 によって酸を発生する光カチオン重合開始剤を配合す る。光カチオン重合開始剤としては、芳香族ジアゾニウ ム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、ホスホニウム 塩、セレノニウム塩等で代表されるオニウム塩類および 金属アレーン錯体がすでに知られており、これらをカチ オン重合性物質と混合して活性エネルギー線を照射する と、活性エネルギー線の照射によって発生したブレンス テッド酸あるいはルイス酸がカチオン重合性物質に作用 して重合を誘発することが、米国特許第4069054 号、同第4450360号、同第4576999号、同 第4640967号、カナダ国特許第1274646号 および欧州特許第203829号において報告されてお b, stAdvances in Polymer S cience 62, Initiators-Pory Reactions-Optical Activi ty, p1~p48, Springer-Verlag (1984)、最新UV硬化技術,技術情報協会編, p 29 (1991年) 等において報告されている。特に、 産業上有用な光カチオン重合開始剤としては、いくつか のトリアリルスルホニウム塩が上市されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、光カチ オン硬化性樹脂組成物は、一般にアクリル酸エステル化 合物等を含有する光ラジカル硬化性樹脂組成物に比べて

硬化速度が遅く、市場からはより硬化性の優れた光カチ オン硬化性樹脂組成物が求められている。硬化速度の向 上しない理由としては、光カチオン重合開始剤そのもの がカチオン重合性化合物に対して溶解性の悪いことが挙 げられる。市場で入手可能なトリアリルスルホニウム塩 を基本構造とした光カチオン重合開始剤の場合は、例え ばフェニルチオ基やスルホニウムカチオンとなっている 硫黄原子に結合しているフェニル基等のような、構造中 に硫黄原子と結合した置換基しかもたないベンゼン環を 有している。このような構造中に硫黄原子との結合のみ の置換基しかもたないベンゼン環を有する場合は、カチ オン重合性化合物に対する光カチオン重合開始剤そのも のの溶解性は低下する傾向にある。そのため、カチオン 重合性化合物に配合して暗所で長期間保存しておくと、 光カチオン重合開始剤成分による結晶化物が発生して沈 殿するなど、保存安定性が悪いことがある。また、構造 中に硫黄原子と直接結合した置換基しかもたないベンゼ ン環を有している光カチオン重合開始剤を含有する樹脂 組成物に活性エネルギー線を照射して硬化したり、また 活性エネルギー線を照射した後、充分な硬化膜を得るた めに加熱処理を施したりした場合、光カチオン重合開始 剤の構造中の比較的結合の弱い炭素原子と硫黄原子の結 合が切れることにより、ベンゼンが遊離する可能性があ る。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者は、前記の課題を解決するため鋭意研究の結果、構造中のすべてのベンゼン環が置換基として炭素原子と直接結合していることを特徴とするトリアリルスルホニウム塩を合成し、これを光カチオン重合開始剤として用い、カチオン重合性化合物に対する光カチオン重合開始剤そのものの溶解性を向上させることによって、透明性、保存安定性および紫外線等の活性エネルギー線照射による硬化性に優れ、さらには得られた硬化膜を加熱処理しても、硬化物の光カチオン重合開始剤成分からベンゼンを発生することのない光カチオン硬化性樹脂組成物を得ることに成功した。すなわち、本発明は、〔1〕下記式(1)

[0005]

【化2】

【0006】(式中、 $R_1 \sim R_5$ はそれぞれ水素原子、 $C_2 \sim C_{18}$ の直鎖または分岐状のアルキル基、トリフルオ

ロメチル基、ペンタフルオロエチル基、シクロヘキシル 基、シクロヘキシルメチル基、ベンジル基、2-ヒドロ キシエチル基、2-メトキシエチル基、2-エトキシエ チル基またはシアノ基からなる群から選ばれるいずれか の置換基を表し、Xは C_1 ~ C_{18} の直鎖または分岐状の アルキル基、トリフルオロメチル基またはペンタフルオ ロエチル基からなる群から選ばれるいずれかの置換基を 表し、Yは1価のアニオンになりうる原子団を表す。た だし、R₁~R₅のすべてが同時に水素原子を表すことは ない。) で表されるトリアリルスルホニウム化合物であ ることを特徴とする光カチオン重合開始剤(A)と、1 種または2種以上のカチオン重合性化合物(B)を含有 することを特徴とする光硬化性樹脂組成物、〔2〕式 (1) において、 $R_1 \sim R_5$ のいずれか1 つがトリフルオ ロメチル基であり、XがC1~C4の直鎖または分岐状の アルキル基、トリフルオロメチル基またはペンタフルオ ロエチル基からなる群から選ばれるいずれかの置換基で ある光カチオン重合開始剤(A)を含有することを特徴 とする〔1〕に記載の光硬化性樹脂組成物、〔3〕式 (1)において、Y⁻で表されるアニオン部がSbF₆-ま たはPF₆-である光カチオン重合開始剤(A)を含有す ることを特徴とする〔1〕または〔2〕に記載の光硬化 性樹脂組成物、〔4〕前記1種または2種以上のカチオ ン重合性化合物(B)のうち、少なくとも1種が1分子 中に1個以上のエポキシ基を有する化合物であることを 特徴とする〔1〕ないし〔3〕のいずれか一項に記載の 光硬化性樹脂組成物、〔5〕光カチオン重合開始剤

(A)の添加量が、前記1種または2種以上のカチオン重合性化合物(B)に対して0.1~10重量%であることを特徴とする[1]ないし[4]のいずれか一項に記載の光硬化性樹脂組成物、[6][1]ないし[5]のいずれか一項に記載の光硬化性樹脂組成物を硬化して得られる硬化物、に関する。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明の前記式(1)で表される 光カチオン重合開始剤(A)は、前記式(1)のカチオ ン部を有する化合物とアニオン部のアルカリ金属塩を反 応させ得ることができる。前記式(1)のカチオン部を 有する化合物は、下記式(2)で表されるベンゼン誘導 体

【0008】 【化3】

【0009】(式中、 $R_1 \sim R_5$ は式(1)におけるのと同じ意味を表す。)とジフェニルスルホキシド誘導体を

用いて、公知のトリアリルスルホニウム塩を生成する反応、例えば特開平7-82244号公報や特開平7-8 2245号公報に記載された方法を利用して合成することができる。

【0010】ここで用いられる前記式(2)で表されるベンゼン誘導体において、 $C_2 \sim C_{18}$ の直鎖または分岐状のアルキル基の具体例としては、例えば、エチル基、n-プロピル基、1-プロピル基、1-プロピル基、1-プチル基、1-ペンテアリル基、1-ペンテアリル基、1-ペンテアリル基、1-ペンテアリル基、1-ペンテアリル基等が挙げられ、その中でも分子量の観点から炭素数 1-ペムのアルキル基が好ましい。ただし、溶解させるカチオン重合性化合物によっては炭素数5以上のアルキル基が好ましいことがある。

【0011】反応に用いうる前記式(2)で表されるべ ンゼン誘導体の具体例としては、例えば、エチルベンゼ ン、oージエチルベンゼン、mージエチルベンゼン、p ージエチルベンゼン、1,2,3-トリエチルベンゼ ン、1,2,4-トリエチルベンゼン、1,2,3,5 ーテトラエチルベンゼン、1,2,4,5ーテトラエチ ルベンゼン、nープロピルベンゼン、イソプロピルベン ゼン、n-ブチルベンゼン、イソブチルベンゼン、te rtーブチルベンゼン、nーペンチルベンゼン、イソペ ンチルベンゼン、n-ヘキシルベンゼン、イソヘキシル ベンゼン、nーヘプチルベンゼン、イソヘプチルベンゼ ン、n-オクチルベンゼン、イソオクチルベンゼン、2 -エチルヘキシルベンゼン、n-デシルベンゼン、イソ デシルベンゼン、n-ラウリルベンゼン、イソラウリル ベンゼン、n-ステアリルベンゼン、イソステアリルベ ンゼン、トリフルオロメチルベンゼン、ペンタフルオロ エチルベンゼン、シクロヘキシルベンゼン、シクロヘキ シルフェニルメタン、ジフェニルメタン、(2-ヒドロ キシエチル) ベンゼン、(2-メトキシエチル) ベンゼ ン、(2-エトキシエチル)ベンゼン、ベンゾニトリル 等を挙げることができる。

【0012】前記式(2)で表される化合物と反応させるジフェニルスルホキシド化合物における置換基(式(1)のX)のうち、炭素数 $1\sim18$ の直鎖または分岐状のアルキル基としては、メチル基および前記 $R_1\sim R_5$ と同様なものが挙げられ、その中でも分子量の観点から炭素数 $1\sim4$ のアルキル基が好ましい。ただし、溶解させるカチオン重合性化合物によっては炭素数5以上のアルキル基が好ましいこともある。

【0013】前記式(2)で表される化合物と反応させるときに用いうるジフェニルスルホキシド化合物の具体例としては、例えば、4,4'ージメチルジフェニルス

ルホキシド、4,4'ージエチルジフェニルスルホキシ ド、4,4'ージーnープロピルジフェニルスルホキシ ド、4,4'-ジイソプロピルジフェニルスルホキシ ド、4,4'ージーnーブチルジフェニルスルホキシ ド、4,4'-ジイソブチルジフェニルスルホキシド、 4, 4'ージーtertーブチルジフェニルスルホキシ ド、4,4'ージーnーペンチルジフェニルスルホキシ ド、4,4'ージイソペンチルジフェニルスルホキシ ド、4,4'ージーnーヘキシルジフェニルスルホキシ ド、4,4'ージイソヘキシルジフェニルスルホキシ ド、4,4'ージーnーヘプチルジフェニルスルホキシ ド、4,4'-ジイソヘプチルジフェニルスルホキシ ド、4,4'ージーnーオクチルジフェニルスルホキシ ド、4,4'ージイソオクチルジフェニルスルホキシ ド、4,4'ージ(2-エチルヘキシル)ジフェニルス ルホキシド、4,4'ージーnーデシルジフェニルスル ホキシド、4,4'-ジイソデシルジフェニルスルホキ シド、4,4'ージーnーラウリルジフェニルスルホキ シド、4,4'ージイソラウリルジフェニルスルホキシ ド、4,4'ージーnーステアリルジフェニルスルホキ シド、4,4'-ジイソステアリルジフェニルスルホキ シド、4,4'ージ(トリフルオロメチル)ジフェニル スルホキシド、4,4'-ジ(ペンタフルオロエチル) ジフェニルスルホキシド等を挙げることができる。

【0014】前記式(2)で表される化合物とジフェニ ルスルホキシド化合物との反応は、酸溶媒中で縮合剤を 用いて行う。用いうる酸溶媒の具体例としては、例え ば、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、トリフルオ ロメタンスルホン酸等を挙げることができる。用いうる 縮合剤の具体例としては、例えば、五酸化二リン、無水 酢酸、ポリリン酸、濃硫酸等を挙げることができる。酸 溶媒の使用量は、縮合剤1重量部に対して通常1~10 0部用いるのが好ましく、より好ましくは5~10部で ある。また縮合剤の使用量は、ジフェニルスルホキシド 化合物1モルに対して通常0.5~10.0モルとする のが好ましく、より好ましくは0.9~1.5モルであ る。反応温度は通常10~100℃とするのが好まし く、より好ましくは20~60℃である。また反応時間 は通常0.5~60時間とするのが好ましく、より好ま しくは2~6時間である。

【0015】本発明の光カチオン重合開始剤(A)は、縮合反応終了後、得られた縮合反応液を水にあけて希釈し、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウムあるいは炭酸カリウム等のアルカリ性のアルカリ金属塩をそのままか、または水溶液として用いてpHを5~7に調整し、前記式(1)におけるYーをアニオン部とするアルカリ金属塩と反応させて塩交換して得ることができる。塩交換は縮合反応液をアルカリ金属塩の水溶液に滴下してもよく、あるいは縮合反応液を必要によ

りさらに水で希釈してこれにアルカリ金属塩の固体を添加してもよい。

【0016】塩交換のときに用いうるアルカリ金属塩の 具体例としては、例えば、LiSbF₆、NaSbF₆、KS bF₆, LiSbF₅OH, NaSbF₅OH, KSbF₅OH, $LiSbF_4$ (OH) 2, $NaSbF_4$ (OH) 2, KSbF4 (OH) 2 LiAsF₆ NaAsF₆ KAsF₆ LiAs F₅OH, NaAsF₅OH, KAsF₅OH, LiAsF $_4$ (OH) $_2$ NaAsF $_4$ (OH) $_2$ KAsF $_4$ (O H)₂, LiPF₆, NaPF₆, KPF₆, LiPF₅OH, NaPF₅OH, KPF₅OH, LiPF₄ (OH)₂, Na PF₄ (OH)₂, KPF₄ (OH)₂, LiBF₄, NaB F₄, KBF₄, LiSbCl₆, NaSbCl₆, KSbCl₆, LiAsCl₆, NaAsCl₆, KAsCl₆, LiPCl₆, Na PCl₆、KPCl₆、LiBCl₄、NaBCl₄、KBCl₄、 LiSbBr₆, NaSbBr₆, KSbBr₆, LiAsBr₆, Na AsBr₆, KAsBr₆, LiPBr₆, NaPBr₆, KPB r₆, LiBBr₄, NaBBr₄, KBBr₄, LiClO₄, Na C1O₄, KC1O₄, CF₃SO₃Li, CF₃SO₃Na, C F_3SO_3K , CH_3SO_3Li , CH_3SO_3Na , CH_3S O₃K、p-トルエンスルホン酸リチウム、p-トルエ ンスルホン酸ナトリウム、p-トルエンスルホン酸カリ ウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ホウ酸リ チウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ホウ酸 ナトリウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ホ ウ酸カリウム、テトラキス (4-フルオロフェニル) ホ ウ酸リチウム、テトラキス (4-フルオロフェニル) ホ ウ酸ナトリウム、テトラキス(4-フルオロフェニル) ホウ酸カリウム等を挙げることができる。これらのアル カリ金属塩の中で、光カチオン重合開始剤の硬化性能を より重視する場合は価格面や入手しやすさからみた場合 はKSbF。が好ましく、また安全性をより重視する場合 はKPF6が好ましい。前記式(2)で表されるベンゼ ン誘導体とジフェニルスルホキシド誘導体の縮合反応液 を前記アルカリ金属塩の水溶液に滴下するときの水溶液 の温度は通常0~80℃がこのましく、より好ましくは 10~40℃である。またアルカリ金属塩の水溶液の濃 度は通常1~30重量%が好ましく、より好ましくは5 ~10重量%である。なお、アルカリ金属塩の水溶液の 量は、容積比で縮合反応液の0.5~30倍であること が好ましく、2~5倍であることがより好ましい。滴下 終了後、1時間程度撹拌を行い、ろ過して水洗し、乾燥 することにより前記式(1)で表される本発明の光カチ オン重合開始剤(A)を得ることができる。

【0017】このようにして得られる本発明の光カチオン重合開始剤(A)の具体的な例としては、例えば、六フッ化アンチモン酸(4-エチルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホニウム、六フッ化リン酸(4-エチルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホニウム、四フッ化ホウ酸(4-エチルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホ

ニウム、過塩素酸(4-エチルフェニル)ジ(4-トル イル) スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸 (4-エチルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホニウ ム、メタンスルホン酸(4-エチルフェニル)ジ(4-トルイル) スルホニウム、p-トルエンスルホン酸(4 ーエチルフェニル)ジ(4ートルイル)スルホニウム、 テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ホウ酸 (4-エ チルフェニル) ジ (4-トルイル) スルホニウム、テト ラキス (4-フルオロフェニル) ホウ酸 (4-エチルフ ェニル)ジ(4-トルイル)スルホニウム、六フッ化ア ンチモン酸(4-イソプロピルフェニル)ジ(4-トル イル) スルホニウム、六フッ化リン酸(4-イソプロピ ルフェニル) ジ(4-トルイル) スルホニウム、四フッ 化ホウ酸(4-イソプロピルフェニル)ジ(4-トルイ ル)スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(4 ーイソプロピルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホニ ウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ホウ酸 (4-イソプロピルフェニル)ジ(4-トルイル)スル ホニウム、六フッ化アンチモン酸(4-n-ブチルフェ ニル) ジ(4-トルイル) スルホニウム、六フッ化リン 酸(4-n-ブチルフェニル)ジ(4-トルイル)スル ホニウム、四フッ化ホウ酸(4-n-ブチルフェニル) ジ(4-トルイル)スルホニウム、トリフルオロメタン スルホン酸 (4-n-ブチルフェニル) ジ (4-トルイ ル)スルホニウム、p-トルエンスルホン酸(4-n-ブチルフェニル) ジ (4-トルイル) スルホニウム、テ トラキス (ペンタフルオロフェニル) ホウ酸 (4-n-ブチルフェニル) ジ (4-トルイル) スルホニウム、六 フッ化アンチモン酸 (4-n-ヘキシルフェニル) ジ (4-トルイル) スルホニウム、六フッ化リン酸(4n-ヘキシルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホニウ ム、四フッ化ホウ酸(4-n-ヘキシルフェニル)ジ (4-トルイル) スルホニウム、トリフルオロメタンス ルホン酸(4-n-ヘキシルフェニル)ジ(4-トルイ ル) スルホニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニ ル) ホウ酸(4-n-ヘキシルフェニル) ジ(4-トル イル)スルホニウム、六フッ化アンチモン酸(4-n-オクチルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホニウム、 六フッ化リン酸 (4-n-オクチルフェニル) ジ (4-トルイル) スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン 酸(4-n-オクチルフェニル)ジ(4-トルイル)ス ルホニウム、六フッ化アンチモン酸(4-(2-エチル ヘキシル)フェニル)ジ(4-トルイル)スルホニウ ム、六フッ化リン酸(4-(2-エチルヘキシル)フェ ニル)ジ(4-トルイル)スルホニウム、トリフルオロ メタンスルホン酸(4-(2-エチルヘキシル)フェニ ル) ジ(4-トルイル) スルホニウム、六フッ化アンチ モン酸(4-n-ラウリルフェニル)ジ(4-トルイ ル)スルホニウム、六フッ化リン酸(4-n-ラウリル フェニル) ジ(4-トルイル) スルホニウム、トリフル

オロメタンスルホン酸 (4-n-ラウリルフェニル) ジ (4-トルイル) スルホニウム、六フッ化アンチモン酸 (4-n-ステアリルフェニル)ジ(4-トルイル)ス ルホニウム、六フッ化リン酸(4-n-ステアリルフェ ニル) ジ(4-トルイル) スルホニウム、トリフルオロ メタンスルホン酸 (4-n-ステアリルフェニル) ジ (4-トルイル) スルホニウム、六フッ化アンチモン酸 (3-トリフルオロメチルフェニル)ジ(4-トルイ ル)スルホニウム、六フッ化リン酸(3-トリフルオロ メチルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホニウム、四 フッ化ホウ酸(3-トリフルオロメチルフェニル)ジ (4-トルイル)スルホニウム、過塩素酸(3-トリフ ルオロメチルフェニル) ジ(4-トルイル) スルホニウ ム、トリフルオロメタンスルホン酸(3-トリフルオロ メチルフェニル) ジ(4-トルイル) スルホニウム、メ タンスルホン酸(3-トリフルオロメチルフェニル)ジ (4-トルイル) スルホニウム、p-トルエンスルホン 酸(3-トリフルオロメチルフェニル)ジ(4-トルイ ル) スルホニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニ ル) ホウ酸(3-トリフルオロメチルフェニル) ジ(4 ートルイル) スルホニウム、テトラキス (4ーフルオロ フェニル) ホウ酸(3-トリフルオロメチルフェニル) ジ(4-トルイル)スルホニウム、六フッ化アンチモン 酸(3-ペンタフルオロエチルフェニル)ジ(4-トル イル)スルホニウム、六フッ化リン酸(3-ペンタフル オロエチルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホニウ ム、四フッ化ホウ酸(3-ペンタフルオロエチルフェニ ル) ジ(4-トルイル) スルホニウム、トリフルオロメ タンスルホン酸(3-ペンタフルオロエチルフェニル) ジ (4-トルイル) スルホニウム、テトラキス (ペンタ フルオロフェニル) ホウ酸(3-ペンタフルオロエチル フェニル) ジ (4-トルイル) スルホニウム、テトラキ ス(4-フルオロフェニル) ホウ酸(3-ペンタフルオ ロエチルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホニウム、 六フッ化アンチモン酸(4-シクロヘキシルフェニル) ジ(4-トルイル)スルホニウム、六フッ化リン酸(4 -シクロヘキシルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホ ニウム、六フッ化アンチモン酸(4-シクロヘキシルメ チルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホニウム、六フ ッ化リン酸(4-シクロヘキシルメチルフェニル)ジ (4-トルイル) スルホニウム、六フッ化アンチモン酸 (4-ベンジルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホニ ウム、六フッ化リン酸 (4-ベンジルフェニル) ジ (4 ートルイル) スルホニウム、六フッ化アンチモン酸(4 - (2-ヒドロキシエチル)フェニル)ジ(4-トルイ ル)スルホニウム、六フッ化リン酸(4-(2-ヒドロ キシエチル) フェニル) ジ(4-トルイル) スルホニウ ム、六フッ化アンチモン酸(4-(2-メトキシエチ ル) フェニル) ジ(4-トルイル) スルホニウム、六フ ッ化リン酸(4-(2-メトキシエチル)フェニル)ジ

(4-トルイル) スルホニウム、六フッ化アンチモン酸 (4-(2-エトキシエチル) フェニル) ジ(4-トル イル) スルホニウム、六フッ化リン酸(4-(2-エト キシエチル)フェニル)ジ(4-トルイル)スルホニウ ム、六フッ化アンチモン酸(4-シアノフェニル)ジ (4-トルイル) スルホニウム、六フッ化リン酸(4-シアノフェニル) ジ (4-トルイル) スルホニウム、六 フッ化アンチモン酸トリ(4-エチルフェニル)スルホ ニウム、六フッ化リン酸トリ(4-エチルフェニル)ス ルホニウム、六フッ化アンチモン酸(4-n-ブチルフ ェニル)ジ(4-エチルフェニル)スルホニウム、六フ ッ化リン酸 (4-n-ブチルフェニル) ジ (4-エチル フェニル) スルホニウム、六フッ化アンチモン酸ジ(4 ーエチルフェニル) 4-n-オクチルフェニルスルホニ ウム、六フッ化リン酸ジ (4-エチルフェニル) 4-n ーオクチルフェニルスルホニウム、六フッ化アンチモン 酸ジ(4-エチルフェニル)4-n-ラウリルフェニル スルホニウム、六フッ化リン酸ジ(4-エチルフェニ ル) 4-n-ラウリルフェニルスルホニウム、六フッ化 アンチモン酸ジ(4-エチルフェニル)4-n-ステア リルフェニルスルホニウム、六フッ化リン酸ジ(4-エ チルフェニル) 4-n-ステアリルフェニル) スルホニ ウム、六フッ化アンチモン酸ジ(4-エチルフェニル) 3-トリフルオロメチルフェニルスルホニウム、六フッ 化リン酸ジ(4-エチルフェニル)3-トリフルオロメ チルフェニルスルホニウム、六フッ化アンチモン酸ジ (4-エチルフェニル) 3-ペンタフルオロエチルフェ ニルスルホニウム、六フッ化リン酸ジ(4-エチルフェ ニル) 3-ペンタフルオロエチルフェニルスルホニウ ム、六フッ化アンチモン酸ジ(4-エチルフェニル)4 - (2-メトキシエチル)フェニルスルホニウム、六フ ッ化リン酸ジ(4-エチルフェニル)4-(2-メトキ シエチル)フェニルスルホニウム、六フッ化アンチモン 酸ジ(4-エチルフェニル)4-シアノフェニルスルホ ニウム、六フッ化リン酸ジ(4-エチルフェニル)4-シアノフェニルスルホニウム、六フッ化アンチモン酸ジ (4-イソプロピルフェニル) 4-トルイルスルホニウ ム、六フッ化リン酸ジ(4-イソプロピルフェニル)4 ートルイルスルホニウム、六フッ化アンチモン酸(3-トリフルオロメチルフェニル)ジ(4-イソプロピルフ ェニル)スルホニウム、六フッ化リン酸(3-トリフル オロメチルフェニル)ジ(4-イソプロピルフェニル) スルホニウム、六フッ化アンチモン酸トリ(4-n-ブ チルフェニル) スルホニウム、六フッ化リン酸トリ(4) -n-ブチルフェニル)スルホニウム、六フッ化アンチ モン酸ジ(4-n-ブチルフェニル)3-トリフルオロ メチルフェニルスルホニウム、六フッ化リン酸ジ(4n-ブチルフェニル)3-トリフルオロメチルフェニル スルホニウム、六フッ化アンチモン酸トリ(4-ter t-ブチルフェニル) スルホニウム、六フッ化リン酸ト

リ (4-tert-ブチルフェニル) スルホニウム、六 フッ化アンチモン酸ジ(4-tert-ブチルフェニ ル) 4-トリフルオロメチルフェニルスルホニウム、六 フッ化リン酸ジ(4-tert-ブチルフェニル)3-トリフルオロメチルフェニルスルホニウム、六フッ化ア ンチモン酸ジ(4-n-ヘキシルフェニル)3-トリフ ルオロメチルフェニルスルホニウム、六フッ化リン酸ジ (4-n-ヘキシルフェニル) 3-トリフルオロメチル フェニルスルホニウム、六フッ化アンチモン酸(3-ト リフルオロメチルフェニル) ジ (4-n-オクチルフェ ニル)スルホニウム、六フッ化リン酸(3-トリフルオ ロメチルフェニル)ジ(4-n-オクチルフェニル)ス ルホニウム、六フッ化アンチモン酸(4-エチルフェニ ν) $\dot{\nu}$ (4-n-ラウリルフェニル) スルホニウム、六 フッ化リン酸(4-エチルフェニル)ジ(4-n-ラウ リルフェニル)スルホニウム、六フッ化アンチモン酸ジ (4-n-ラウリルフェニル) 3-トリフルオロメチル フェニルスルホニウム、六フッ化リン酸ジ(4-n-ラ ウリルフェニル) 3-トリフルオロメチルフェニルスル ホニウム、六フッ化アンチモン酸(4-エチルフェニ ル) ジ(4-n-ステアリルフェニル) スルホニウム、 六フッ化リン酸(4-エチルフェニル)ジ(4-n-ス テアリルフェニル)スルホニウム、六フッ化アンチモン 酸ジ(4-n-ステアリルフェニル)3-トリフルオロ メチルフェニルスルホニウム、六フッ化リン酸ジ(4n-ステアリルフェニル) 3-トリフルオロメチルフェ ニルスルホニウム、六フッ化アンチモン酸(4-エチル フェニル)ジ(4-トリフルオロメチルフェニル)スル ホニウム、六フッ化リン酸(4-エチルフェニル)ジ (4-トリフルオロメチルフェニル) スルホニウム、六 フッ化アンチモン酸(3-トリフルオロメチルフェニ ル)ジ(4-トリフルオロメチルフェニル)スルホニウ ム、六フッ化リン酸(3-トリフルオロメチルフェニ ル) ジ(4-トリフルオロメチルフェニル) スルホニウ ム、トリフルオロメタンスルホン酸(3-トリフルオロ メチルフェニル) ジ(4-トリフルオロメチルフェニ ル) スルホニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニ ル) ホウ酸(3-トリフルオロメチルフェニル) ジ(4 ートリフルオロメチルフェニル) スルホニウム、六フッ 化アンチモン酸(4-エチルフェニル)ジ(4-ペンタ フルオロエチルフェニル) スルホニウム、六フッ化リン 酸(4-エチルフェニル)ジ(4-ペンタフルオロエチ ルフェニル)スルホニウム、六フッ化アンチモン酸ジ (4-ペンタフルオロエチルフェニル) 3-トリフルオ ロメチルフェニルスルホニウム、六フッ化リン酸ジ(4 ーペンタフルオロエチルフェニル)3ートリフルオロメ チルフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホ ン酸ジ(4-ペンタフルオロエチルフェニル)3-トリ フルオロメチルフェニルスルホニウム、テトラキス (ペ ンタフルオロフェニル) ホウ酸ジ (4-ペンタフルオロ

エチルフェニル) 3 – トリフルオロメチルフェニルスル ホニウム等を挙げることができる。

【0018】これら本発明の光カチオン重合開始剤

(A)の中で好ましいものの例としては、例えば、六フ ッ化アンチモン酸(3-トリフルオロメチルフェニル) ジ(4-トルイル)スルホニウム、六フッ化リン酸(3) ートリフルオロメチルフェニル) ジ (4ートルイル) ス ルホニウム、六フッ化アンチモン酸ジ(4-n-ブチル フェニル) 3-トリフルオロメチルフェニルスルホニウ ム、六フッ化リン酸ジ(4-n-ブチルフェニル)3-トリフルオロメチルフェニルスルホニウム、六フッ化ア ンチモン酸ジ (4-tert-ブチルフェニル) 3-ト リフルオロメチルフェニルスルホニウム、六フッ化リン 酸ジ(4-tert-ブチルフェニル)3-トリフルオ ロメチルフェニルスルホニウム、六フッ化アンチモン酸 (3-トリフルオロメチルフェニル)ジ(4-トリフル オロメチルフェニル)スルホニウム、六フッ化リン酸 (3-トリフルオロメチルフェニル)ジ(4-トリフル オロメチルフェニル)スルホニウム等を挙げることがで きる。

【0019】次に、本発明の光硬化性樹脂組成物について説明する。本発明の光硬化性樹脂組成物は、本発明の光力チオン重合開始剤(A)およびカチオン重合性化合物(B)を含有する。カチオン重合性化合物(B)をしては、例えば、エポキシ基を有する化合物(a)、ビニル化合物(b)、ジシクロオルソエステル化合物(c)、スピロオルソカーボネート化合物(d)、オキセタン環を有する化合物(e)等を挙げることができる。これらは単独もしくは2種以上を併用して用いても差し支えない。(a)~(e)の中で、特に(a)のエポキシ基を有する化合物と(e)のオキセタン環を有する化合物が好んで使用される。

【0020】用いうるエポキシ基を有する化合物(a) の具体例としては、3、4-エポキシシクロヘキシルメ チルー3, 4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレー ト、ビスー(3,4-エポキシシクロヘキシル)アジペ ート、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル-5,5 ースピロー3,4-エポキシ)シクロヘキサノンーメタ ージオキサン、ビスー(2,3-エポキシシクロペンチ ル) エーテル、リモネンジオキサイド、4 - ビニルシク ロヘキセンジオキサイド、フェニルグリシジルエーテ ル、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノール F型エポキシ樹脂、水添ピスフェノールA型エポキシ樹 脂、臭素化ビスフェノールA型エポキシ樹脂等のビスフ ェノール型エポキシ樹脂、フェノール・ノボラック型エ ポキシ樹脂、クレゾール・ノボラック型エポキシ樹脂、 臭素化フェノール・ノボラック型エポキシ樹脂等のノボ ラック型エポキシ樹脂、多価アルコールのポリグリシジ ルエーテル等が挙げられる。

【0021】用いうるビニル化合物(b)の具体例とし

ては、例えば、スチレン、α-メチルスチレン、p-ク ロルメチルスチレン等のスチレン類;n-ブチルビニル エーテル、イソブチルビニルエーテル、シクロヘキシル ビニルエーテル、ヒドロキシブチルビニルエーテル等の アルキルビニルエーテル類; アリルビニルエーテル、1 -オクタヒドロナフチルビニルエーテル等のアルケニル ビニルエーテル類:エチニルビニルエーテル、1-メチ ルー2ープロペニルビニルエーテル等のアルキニルビニ ルエーテル類; フェニルビニルエーテル、p-メトキシ フェニルビニルエーテル等のアリールビニルエーテル 類;ブタンジオールジビニルエーテル、トリエチレング リコールジビニルエーテル、シクロヘキサンジオールジ ビニルエーテル等のアルキルジビニルエーテル類; 1, 4-ベンゼンジメタノールジビニルエーテル、m-フェ ニレンビス (エチレングリコール) ジビニルエーテル等 のアラルキルジビニルエーテル類: ハイドロキノンジビ ニルエーテル、レゾルシノールジビニルエーテル等のア リールジビニルエーテル類等が挙げられる。

【0022】用いうるジシクロオルソエステル化合物 (c)の具体例としては、例えば、1-フェニル-4-エチル2, 6, 7-トリオキサビシクロ〔2, 2, 2〕 オクタン、1-エチル-4-ヒドロキシメチル-2, 6,7-トリオキサビシクロ[2,2,2]オクタン等 が挙げられる。 用いうるスピロオルソカーボネート化 合物(d)の具体例としては、例えば、1,5,7,1 1-テトラオキサスピロ〔5,5〕ウンデカン、3,9 ージベンジルー1,5,7,11ーテトラオキサスピロ 〔5,5〕ウンデカン等や1,4,6-トリオキサスピ ロ〔4,4〕ノナン、1,4,6-トリオキサスピロ 〔4,5〕デカン等が挙げられ、オキセタン環を有する 化合物(e)としては、例えば、3、3ージメチルオキ セタン、3,3-ビス(クロロメチル)オキセタン、2 -ヒドロキシメチルオキセタン、3-メチル-3-オキ セタンメタノール、3-メチル-3-メトキシメチルオ キセタン、3-エチル-3-フェノキシメチルオキセタ ン、レゾルシノールビス(3-メチル-3-オキセタニ ルエチル) エーテル、mーキシリレンビス(3-エチル -3-オキセタニルエチルエーテル) 等を挙げることが できる。 なおこれらは、 単独もしくは2種以上を併用し て用いてもよい。

【0023】本発明の光硬化性樹脂組成物を構成する各成分の使用割合は、カチオン重合性化合物(B)100 重量部に対して、光カチオン重合開始剤(A)は通常 0.1 \sim 10重量部であることが好ましく、より好ましくは1 \sim 5重量部である。

【0024】本発明の光硬化性樹脂組成物には、さらに 光増感剤を添加して配合することによって活性エネルギー線に対する感度を向上させることができ、より硬化速 度の速い光硬化性樹脂組成物とすることができる。ここ で用いうる光増感剤の具体例としては、例えば、ナフタ レン誘導体、アントラセン誘導体、フェナントレン誘導 体、ナフタセン誘導体、クリセン誘導体、ペリレン誘導 体、ペンタセン誘導体、アクリジン誘導体、ベンソチア ゾール誘導体、ベンゾイン誘導体、フルオレン誘導体、 ナフトキノン誘導体、アントラキノン誘導体、キサンテ ン誘導体、キサントン誘導体、チオキサンテン誘導体、 チオキサントン誘導体、クマリン誘導体、ケトクマリン 誘導体、シアニン誘導体、アクリジン誘導体、アジン誘 導体、チアジン誘導体、オキサジン誘導体、インドリン 誘導体、アズレン誘導体、トリアリルメタン誘導体、フ タロシアニン誘導体、スピロピラン誘導体、スピロオキ サジン誘導体、チオスピロピラン誘導体、有機ルテニウ ム錯体等が挙げられ、その中でも好ましいものとしては ナフタレン誘導体、アントラセン誘導体、フェナントレ ン誘導体、クリセン誘導体、ペリレン誘導体、アクリジ ン誘導体を挙げることができ、それらの中でも特に炭素 数1~4のアルキル基を置換基として有してもよい9. 10-ジアルコキシアントラセン誘導体あるいは9.1 0-ジ(アルコキシアルコキシ)アントラセン誘導体が 好ましい。

【0025】炭素数1~4のアルキル基を置換基として 有してもよい9、10-ジアルコキシアントラセン誘導 体あるいは9,10-ジ(アルコキシアルコキシ)アン トラセン誘導体の具体例としては、例えば、9、10-ジメトキシアントラセン、2-エチル-9,10-ジメ トキシアントラセン、2-tert-ブチル-9,10 ージメトキシアントラセン、2,3ージメチルー9,1 0-ジメトキシアントラセン、9、10-ジエトキシア ントラセン、2-エチル-9,10-ジエトキシアント ラセン、2-tert-ブチル-9,10-ジエトキシ アントラセン、2,3-ジメチル-9,10-ジエトキ シアントラセン、9,10-ジ(n-プロポキシ)アン トラセン、2-エチル-9,10-ジ(n-プロポキ シ) アントラセン、9、10-ジイソプロポキシアント ラセン、2-エチル-9,10-ジイソプロポキシアン トラセン、9,10-ジ(2-メトキシエトキシ)アン トラセン、2-エチル-9,10-ジ(2-メトキシエ トキシ) アントラセン、2-tert-ブチル-9, 1 0-y(2-y)+2y+2yージメチルー9,10ージ(2-メトキシエトキシ)ア ントラセン、9,10-ジ(n-ブトキシ)アントラセ ン、2-エチル-9,10-ジ(n-ブトキシ)アント ラセン、9、10-ジ(2-エトキシエトキシ)アント ラセン、2-エチル-9,10-ジ(2-エトキシエト キシ) アントラセン、9, 10-ジベンジルオキシアン トラセン、2-エチル-9,10-ジベンジルオキシア ントラセン、2-tert-ブチル-9,10-ジベン ジルオキシアントラセン、2,3-ジメチル-9,10 ージベンジルオキシアントラセン、9,10ージ(2-カルボキシエトキシ)アントラセン、2-エチル-9.

10-ジ(2-カルボキシエトキシ) アントラセン等を挙げることができる。

【0026】本発明の光硬化性樹脂組成物には、さらに 硬化性を損なわない範囲で希釈のための溶剤や消泡剤、 レベリング剤、増粘剤、難燃剤、酸化防止剤、光安定 剤、充填剤、静電防止剤、流動調整剤、カップリング剤 等の各種添加剤を混合することができる。

【0027】本発明の光硬化性樹脂組成物は、上記各成 分を所定の割合で均一に混合することによって得ること ができ、紫外線等の活性エネルギー線を照射して容易に その硬化物とすることができる。硬化は本発明の光硬化 性樹脂組成物を通常O. 01~1mm程度の厚さにした 後、活性エネルギー線を照射する。適当な活性エネルギ 一線としては、光カチオン重合開始剤の分解を誘発する エネルギーを有するのであればいかなるものでもよい が、好ましくは高圧水銀ランプ、低圧水銀ランプ、キセ ノンランプ、メタルハライドランプ、殺菌灯、レーザー 光からなる2000~7000オングストロームの波長 を有する電磁波エネルギー、電子線、X線、紫外線等の 光エネルギー線が挙げられる。活性エネルギー線の照射 時間は、その強度にもよるが、通常は0.1~10秒程 度で充分である。しかし膜厚が比較的厚い塗装膜につい ては、それ以上の時間をかけるのが好ましい。活性エネ ルギー線照射後0.1~数分後には、ほとんどの光硬化 性樹脂組成物は光カチオン重合および光ラジカル重合に より硬化して指触乾燥するが、使用するカチオン重合性 化合物(B)の種類および配合比によっては、活性エネ ルギー線照射時に光硬化性樹脂組成物を30~100℃ 程度に加熱することにより、重合反応を効果的に促進し て、より硬化速度を向上させることが可能である。また 活性エネルギー線を照射して得られた硬化物を、重合に よる硬化を完結させる目的で、さらに50~250℃に 加熱処理することもできる。加熱処理する場合、光硬化 性樹脂組成物を塗装する基材や得られる硬化物の耐熱性 等を考慮し、100℃以上の高温で加熱処理する場合 は、なるべく短時間で加熱処理を行う方が好ましい。

【0028】本発明の光硬化性樹脂組成物の具体的な用途としては、塗料、コーティング剤、インキ、レジスト、液状レジスト、接着剤、成形材料、パテ、ガラス繊維含浸剤、目止め剤、光学的造形用注型剤等を挙げることができ、例えばコーティング剤として適用できる基材としては金属、木材、ゴム、プラスチック、ガラス、セラミック製品等を挙げることができる。

【0029】

【実施例】以下、本発明の実施例により、さらに具体的 に説明する。ただし本発明はこれらの実施例に限定され るものではない。

【0030】光カチオン重合開始剤(A)の合成例 実施例1:100mlのセパラブルフラスコにメタンス ルホン酸60.6gを入れ、撹拌しながらトリフルオロ メチルベンゼン7.2gおよび4,4'-ジメチルジフ ェニルスルホキシド11.4gを加え、そのまま20℃ で撹拌した。この混合物に無水酢酸9.2gを発熱に注 意しながら滴下した。無水酢酸を全量滴下した後、10 分程度そのまま撹拌してから昇温し、50~60℃で5 時間撹拌した。反応液を20~25℃まで冷却後、11 のビーカーに入れた水350m1に撹拌しながら加え、 さらに25%水酸化ナトリウム水溶液を溶液のpHが5 ~7になるまで加えた。中和後、反応液を希釈した水を 冷暗所に氷冷して1時間放置し、上澄み液をデカンテー ションで除去した後、水500m1を加えて激しく撹拌 して残存物を溶解した。溶液が均一な淡褐色の透明液体 になってから、あらかじめ粉砕しておいた六フッ化リン 酸カリウム9.8gを加え、そのまま1時間撹拌した 後、析出した白色の結晶をろ別した。得られた結晶を水 11で洗浄し、さらに結晶をエタノールを用いて再結晶 して精製して24時間風乾した後、40℃で真空乾燥し て目的とする六フッ化リン酸(3-トリフルオロメチル フェニル) ジ(4-hルイル) スルホニウム17.4g(収率69.9%)を得た。得られた六フッ化リン酸 (3-トリフルオロメチルフェニル)ジ(4-トルイ ル)スルホニウムは白色~乳白色の粉末であり、融点は 118~121℃であった。得られた生成物の元素分析 の結果を表1に示す。

【0031】表1

元素	実測値(重量%)	計算値 (重量%)
С	50.12	50.00
Н	3.58	3.60
S	6.35	6.36

【0032】実施例2:実施例1と同様な方法で、六フッ化リン酸カリウム9.8gの代わりに六フッ化アンチモン酸カリウム14.5gを用いることにより、目的とする六フッ化アンチモン酸(3-トリフルオロメチルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホニウム17.9g(収率61.1%)を得た。得られた六フッ化アンチモン酸(3-トリフルオロメチルフェニル)ジ(4-トルイル)スルホニウムは白色〜乳白色の粉末であり、融点は110〜113℃であった。得られた生成物の元素分析の結果を表2に示す。

【0033】表2

元素	実測値(重量%)	計算值(重量%)
С	42.43	42.38
Н	3.05	3.05
S	5.41	5.39

【0034】樹脂組成物の実施例

実施例3、4:表3に示す配合組成(数値は重量部である)に従って樹脂組成物を配合し、混合溶解した。なお表3に示した配合組成物は、あらかじめ実施例1および2で合成した光カチオン重合開始剤の2重量部をそれぞれアーブチロラクトン2重量部に溶解し、これにカチオ

ン重合性化合物を配合して加熱溶解することにより調製 した。これら配合組成物の硬化膜は、表3に従って調製 した配合組成物をアルミテストパネル上に5μの厚さに 塗布したのち、高圧水銀灯(80W/cm)で8cmの 距離から紫外線を照射して得た。このようにして得られ た硬化膜について、指触乾燥性、透明性、保存安定性お よび硬化塗膜の光沢を下記のようにして試験した。試験 結果を表3に併せて示す。

【0035】指触乾燥性:指やガーゼ等で触れてみたと きに、表面に傷がつかなくなるまでの紫外線照射量をm J/c m²で表示した。

実施例1で得た生成物 実施例2で得た生成物 アーブチロラクトン
セロキサイド2021 *1
EHPE-3150 * 2
指触乾燥性
透明性
保存安定性
光沢

【0040】注)

*1:ダイセル化学工業社製、脂環式エポキシ樹脂 *2:ダイセル化学工業社製、脂環式エポキシ樹脂 【0041】実施例5、6、比較例1

表4に示す配合組成(数値は重量部である)に従って樹 脂組成物を配合し、混合溶解した。 なお表4 に示した配 合組成物は、あらかじめ光カチオン重合開始剤の3重量 部をそれぞれアーブチロラクトン3重量部に溶解し、こ れにカチオン重合性化合物を配合して加熱溶解すること により調製した。これら配合組成物の硬化膜は、表4に 従って調製した配合組成物を70mm×60mmにカッ トしたPETフィルムにバーコーターで塗布し、高圧水

【0036】透明性:配合物を試験管等の透明な容器に 入れて目視で判定した。

○・・・濁りや沈殿物がない。

【0037】保存安定性:樹脂組成物を40℃で3ヶ月 間保存し、安定性を調査した。

○・・・粘度に変化がなく、結晶化物が発生しない。 【0038】光沢:指触乾燥するまで紫外線を照射した 後、硬化塗膜の表面を目視で判定した。

○・・・光沢が良好である。

[0039]

	実施例
3	4
2	
	2
2	2
80	80
20	20
65	25
0	0
0	0
0	0

銀灯(80W/cm)で8cmの距離から紫外線を照射 量100mJ/cm2で照射して硬化した。硬化後、硬 化膜のついたPETフィルムを十分に気密性を確認した 100m1のガラス製バイアルびんになるべく膜面が重 なり合わないように入れ、密封した後、110℃電気炉 中で加熱した。冷却後、バイアルびん中のガスを1m1 採取し、ガスクロマトグラフでベンゼンを定量した。な おベンゼンの定量にあたってはある一定量の濃度のベン ゼンをガスクロマトグラフで分析し、ベンゼンの濃度を 検量線で求めた後、ベンゼンの検出量を硬化膜1 m² あ たりのmgで表示した。試験結果を表4に併せて示す。 [0042]

表4

		実施例		比較例
		5	6	1
実施例1で得た生成物		3		
実施例2で得た生成物			3	
トリアリルスルホニウム化合物・	∗ 3			3
ァーブチロラクトン		3	3	3
UVR-6110 *4		50	50	50
UVR-6128 *5		50	50	50
硬化膜の重量 (mg)		65.2	68.9	63.2
開始剤の含有量(mg)		1.85	1.95	1.79
塗布面積(cm²)		42	42	42
ベンゼンの検出量(mg/m²)		検出せず	検出せず	0.6
			د سف سال در س	

【0043】注)

*3: 六フッ化リン酸(4-フェニルチオフェニル)ジ

フェニルスルホニウム

*4:ユニオンカーバイド社製、脂環式エポキシ樹脂

*5:ユニオンカーバイド社製、脂環式エポキシ樹脂【0044】なお表4における比較例1でトリアリルスルホニウム化合物として使用した六フッ化リン酸(4-フェニルチオフェニル)ジフェニルスルホニウムは、実施例1と同様な方法で、トリフルオロメチルベンゼン7.2gの代わりにジフェニルスルフィド9.2gを用い、4,4'-ジメチルジフェニルスルホキシド11.4gの代わりにジフェニルスルホキシド10.0gを用いることにより、目的とする六フッ化リン酸(4-フェニルチオフェニル)ジフェニルスルホニウム20.5g(収率80.4%)を得た。得られた六フッ化リン酸(4-フェニルチオフェニル)ジフェニルスルホニウムは白色〜乳白色の粉末であり、融点は116〜118℃であった。得られた生成物の元素分析の結果を表5に示す。

【0045】表5

元素	実測値(重量%)	計算値(重量%)
С	55.86	55.79
Н	3.78	3.72
S	12.38	12.42
[004	46]	

【発明の効果】本発明で得られるトリアリルスルホニウム塩は、カチオン重合性物質の光重合を行う際に光カチオン重合開始剤として使用することが可能である。また本発明で得られるトリアリルスルホニウム塩を配合した光硬化性樹脂組成物は保存安定性に優れ、活性エネルギー線を照射することにより光硬化することが可能であ

一線を照射することにより光硬化することが可能である。また、本発明の樹脂組成物から光照射して得られる硬化膜は、さらに加熱処理を施しても硬化物の光カチオン重合開始剤成分から有害物であるベンゼンを発生する

ことがない。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4H006 AB40 AB49

4J005 AA07 BB01 BB02

4J011 QA08 QA09 QA19 QA20 QA34

SA62 SA63 SA64 SA72 SA74

SA78 SA83 SA84 SA85 SA87

UA01 UA02 UA08 VA01 WA01

WA02 WA06 WA07

4J036 AD08 AD09 AF06 AJ01 AJ09

AJ10 AJ16 GA03 GA23 HA01

HA02 HA03 JA01 JA06 JA07

JA09 JA11